



Рис. 7. Зависимость плотности обратного тока через структуру Ni – V/Pt/Si от температуры БТО при толщине слоя сплава Ni – V 20; 40 и 60 нм

Fig. 7. The dependence of revers current density through Ni – V/Pt/Si structure on the rapid heat treatment temperature at a Ni – V alloy layer thickness of 20; 40 and 60 nm